

武汉理工大学

武汉理工大学 2010 年研究生入学考试试题

课程代码 833 课程名称 材料科学基础

(共 3 页, 共八题, 答题时不必抄题, 标明题目序号即可;

相平衡题目直接做在试卷上, 不必另外画图 !!)

一、 基本概念 (30 分)

1. 空间利用率、空隙填充率
2. 位错滑移、位错爬移
3. 玻璃网络形成体、玻璃网络外体
4. 穿晶断裂、蠕变断裂
5. 应力腐蚀、晶间腐蚀
6. 初次再结晶、二次再结晶
7. 均态核化、非均态核化
8. 矿化剂

二、 作图题 (10 分)

1. 在面心立方晶胞中标示出质点以 ABCABC…规律重复的堆积方式。(5 分)
2. 画出面心立方晶胞中质点在 (111) 晶面上的投影图。(5 分)

三、 绿宝石 $\text{Be}_3\text{Al}_2[\text{Si}_6\text{O}_{18}]$ 上半个晶胞在 (0001) 面上的投影如图 1 所示, 整个晶胞的结构按照标高 50 处的镜面经反映即可得到。根据图 1 回答下列问题:

(20 分)

1. 绿宝石的氧硅比为多少? 硅氧四面体组成的是什么结构? (4 分)
2. Be 和 Al 分别与周边什么标高的几个氧配位? 构成的配位多面体是什么? 它们之间又是如何连接的? (8 分)
3. 用 Pauling 的连接规则说明标高 65 的氧电价是否平衡? (4 分)
4. 根据结构说明绿宝石热膨胀系数不高、当半径小的 Na^+ 存在时, 在直流电场下具有显著离子电导的原因。(4 分)

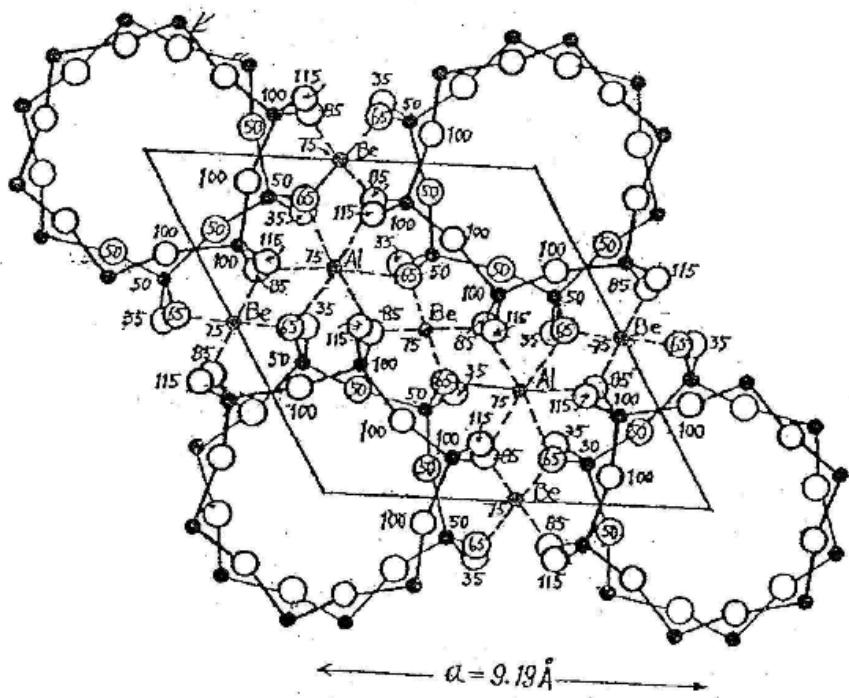


图 1 绿宝石晶胞结构

四、A-B-C 三元系统相图如图 2 所示，根据相图回答下列问题：
(25 分)

- 在图上划分副三角形、用箭头表示个别界线上下降方向及界线的性质；(8 分)
- 判断化合物 S₁、S₂ 的性质；(2 分)
- 写出各三元无变量点的性质及其对应的平衡关系式；(5 分)
- 写出熔体 1、2 在完全平衡冷却下的冷却结晶过程；(10 分)

五、假设自组成为 $18\text{Na}_2\text{O} \cdot 10\text{CaO} \cdot 72\text{SiO}_2$ (wt%) 和 $8\text{Na}_2\text{O} \cdot 4\text{CaO} \cdot 88\text{SiO}_2$ (wt%) 两种熔体中，均态成核析出石英相。(15 分)

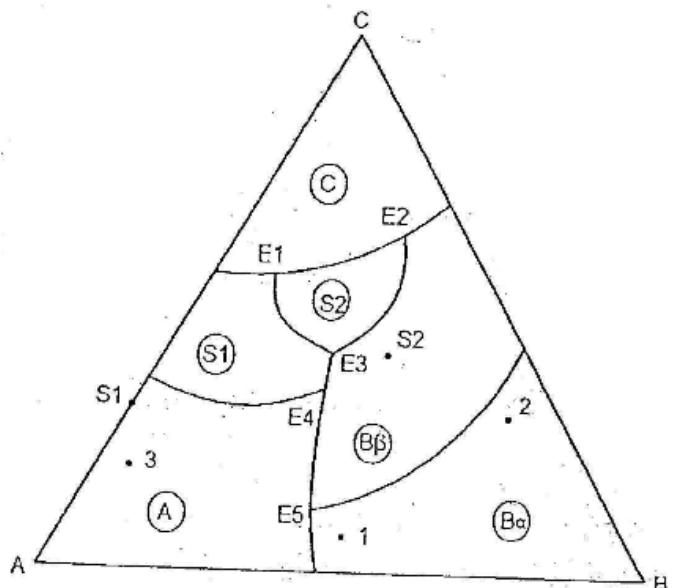


图 2 第四题图

- 设形成晶核为球形，两者相变时除过界面能外单位体积自由焓 ΔG_V 的变化相同，请推导熔体析晶时的核化势垒和临界晶核半径；(5分)
- 考虑到两熔体组成及表面张力的差异，试比较两者的临界晶核半径的大小并解释其原因？(5分)
- 假设新相的晶核形成后，新相长大的速率均取决于溶质原子在熔体中的扩散。在外界条件均相同的情况下，试比较两种熔体中石英相的长大速率，并解释其原因。(5分)

六、晶体结构缺陷(15分)

- CaO 形成肖特基缺陷，写出其缺陷反应方程式，并计算单位晶胞 CaO 的肖特基缺陷数（已知 CaO 的密度是 3.0 克 / 厘米³，其晶格参数是 0.481nm）。(4分)
- CsCl 溶入 MgCl_2 中形成空位型固溶体，并写出固溶体的化学式。(3分)
- Al_2O_3 掺入到 MgO 中，请写出二个合理的方程，并判断可能成立的方程是哪一种？写出其固溶体的化学式。(5分)
- 根据 2 和 3 总结杂质缺陷形成规律。(3分)

七、根据玻璃的形成条件，对 SiO_2 、 $\text{K}_2\text{O}\cdot\text{SiO}_2$ 和 $\text{K}_2\text{O}\cdot2\text{SiO}_2$ 等几种物质形成玻璃的难易程度，热膨胀系数、电导率和熔融温度的大小进行排序，并说明理由。(15分)

八、选做题：下列 3 题中任选 1 题 (20 分)

- 试简要说明原始粉料的粒度、物料活性、添加物、气氛、压力等因素对烧结的影响规律。
- 已知 Al_2O_3 和 SiO_2 粉末形成莫来石反应由扩散控制，实验在恒定温度下进行，当反应进行 1 小的时候，测知已有 15% 的反应物起了反应。(1) 分别用扬德方程、金斯托林格方程计算完全反应的时间。(2) 试判断哪个结果更接近实际情况？为什么？(3) 若要加速莫来石的生产可以采取什么有效措施？至少举出一种措施。
- 金属表面的渗碳属于恒定源扩散，其浓度分布曲线为 $c(x,t) = c_s [1 - \operatorname{erf}(\frac{x}{2\sqrt{Dt}})]$ 。已知碳在 800 度时扩散进入钢表面以下 0.1cm 深度处需要 10h。已知碳原子在面心立方铁中的扩散活化能为 137522J/mol。(1) 如果希望在 5h 内达到同样的深度，该渗碳过程应在多少温度下进行？(2) 现希望在钢表面以下 0.2cm 深度处具有相同的碳原子深度，有人建议在相同的热处理温度下延长至 20h，这种方法可行吗？为什么？(3) 如果热处理时间保持 10h 不变，你还能提出什么措施达到与(2)同样的目的？具体该如何进行？